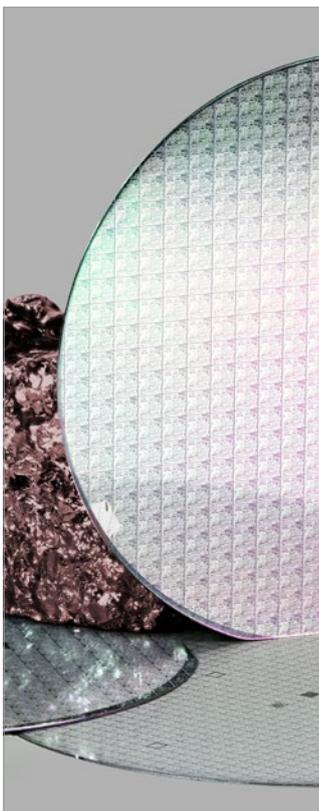




Stand: 20. März 2025



Cu(II)Oxid hochreines Metallsalz



Niedrigere Betriebskosten für die Cu-Ergänzung möglich

Die hochreinen Umicore-Kupferoxid-Metalloxidpulver werden in Übereinstimmung mit den anspruchsvollen Anforderungen der modernen advanced packaging Industrie entwickelt, hergestellt und qualitätsgeprüft. In Kombination mit dem ancosys DMR®-Konzept (Direct Metal Replenishment) ist eine Reinraumnutzung möglich, die niedrigere Betriebskosten für die Cu-Ergänzung zusammen mit einer Leistungssteigerung des Elektrolyten durch höhere Cu-Konzentrationen ermöglicht.

Vorteile

- Keine VMS erforderlich
- H₂SO₄-Konzentration bleibt konstant. Stabiles Elektrolytvolumen, regelmäßige Ergänzung und Verwerfung von Elektrolyt nicht notwendig
- Mehrere Sorten (4N, Packaging)
- Vollständige Rückverfolgbarkeit, nur eine Quelle für Cu
- Kosteneffizienz
- Reduzierung der Anlagenstillstandszeit, Unterstützung wartungsfreier Galvanisierzellen
- 50% geringere Kosten pro kg Cu im Vergleich zu VMS
- 15% höhere Geschwindigkeit durch höheren Cu-Gehalt (60g/l i/o 50g/l)

Anwendungen

- Halbleitertechnik

Cu(II)Oxid hochreines Metallsalz

TECHNISCHE DATEN

Picture: Courtesy ancosys GmbH

	Umicore CuO PG	Umicore CuO HG	Umicore CuO 4N
Application	RDL and panel level substrates	Panel substrates	Fine line RDL and Pillar
Purity	99,9 %	99,9%	99,99%
auto-dosing compatibility DMR	✓	-	✓
Dissolution speed	★	★	★★
High Speed Plating	✓	✓	✓
Clean room packed / compatible	✓	-	✓



ANSPRECHPARTNER

Sie haben tieferegehende Fragen oder wünschen eine unverbindliche Angebotskalkulation? Unsere Fachleute helfen Ihnen, natürlich auch bei technischen Fragen, gerne weiter.



Andrea Grau
Leiterin Vertrieb Europa

E-Mail: andrea.grau@eu.umicore.com
Telefon: +49 (0) 7171 607 - 229

